

平成28年度第2回

参加費無料

技術シーズ説明会 マッチング会

平成29年3月3日(金) 14:00～17:00
(受付開始 13:30～)

東京都知的財産総合センターでは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県のご公設試験研究機関が保有する特許等の技術シーズを活用した中小企業の新製品開発・自社製品の付加価値向上等を支援するため、「技術シーズ発表会・マッチング会」を開催します。個別面談も実施いたしますので、新たな事業展開に向け、是非ご参加ください。

※後半のマッチング会は予約制です。

テーマ	公設試験研究機関の利用で製品開発のスピードアップ！		
会場	地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター 本部 東京イノベーションハブ（江東区青海2-4-10）※裏面地図をご覧ください。		
内容	14:00 開会 14:05～14:55 セミナーの部 (1)公設試験研究機関の特許を活用した事業化事例 ～礬素規制に対応したクエン酸ニッケルめっきの開発～ 株式会社金属化工技術研究所 取締役常務 高橋邦雄 氏 (2)首都圏テクノナレッジ・フリーウェイ(TKF)のご紹介 15:00～17:00 技術プレゼンテーション・マッチング会 (1)技術プレゼンテーション・質疑応答 ①埼玉県産業技術総合センター 2件 ②千葉県産業支援技術研究所 1件 ③東京都立産業技術研究センター 2件 ④神奈川県産業技術センター 2件 ※プレゼンテーションの概要は、裏面をご参照ください。 ※最新情報は当センターホームページでご確認ください。 (2)マッチング会(個別面談／予約制) ※1コマ30分で実施します。(15:00～、15:30～、16:00～、16:30～) ※当センターホームページからお申込みください。 17:00 閉会		
対象	都内中小企業の皆さま	定員	50名

◆ 申込方法 ◆

当センターホームページ(<http://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/>)からお申込みください。

お問合わせは、東京都知的財産総合センター(台東区台東1-3-5 反町商事ビル1階)

製品化支援担当までお気軽にどうぞ (電話)03-3832-3656

スケジュール

14:00	開会		
14:05 ～14:50	セミナー「公設試験研究機関の特許を活用した事業化事例」 ～礬素規制に対応したクエン酸ニッケルめっきの開発～ 株式会社金属化工技術研究所 取締役常務 高橋邦雄 氏		
14:50 ～14:55	首都圏テクノレッジ・フリーウェイ(TKF)のご紹介		
14:55	休憩(5分)		
15:00	発表機関	プレゼンテーションテーマ	概要
15:00 ～15:40	埼玉県 産業技術 総合センター	低周波振動ドリルによる 微細深穴加工 (20分)	工具軸方向に低周波振動を付加する「微細深穴加工」における切り屑の細分化、 工具の長寿命化の検討。微細深穴加工用の振動テーブルや振動スピンドルの 開発などが想定されます。
		手動ナノステージ (20分)	従来の手動式ステージよりも高分解能な新方式のステージ(手動超精密ステー ジ、微小アクチュエータ等)の開発などにつながる技術です。
15:40 ～16:00	千葉県 産業支援技術 研究所	メカニカルコーティング法の紹介 ～環境浄化複合光触媒薄膜の 開発を例に～ (20分)	機械摩擦固着を利用したメカニカルコーティング法(Mechanical Coating Technique, MCT) 複雑形状・立体的形状の担体に簡便かつ経済的に金属薄膜を作製できる技術。 この技術を用いてアルミナボール上にTi複合光触媒薄膜を成膜し、その後熱処 理することにより光触媒膜を作製した事例や、その光触媒機能も紹介します。
16:00 ～16:40	東京都立 産業技術 研究センター	漆と間伐材の木粉を用いた 100%バイオマス成形材料 及び成形体 (20分)	漆と植物繊維(スギ木粉)のみで成形材料を開発し、漆工製品の素地を成形可能 漆工芸の活用による「和」をテーマとした商品開発、海外へCool Japan製品と しての展開、天然材料の漆・バイオマス100%といったキーワードから環境を特 徴とする高付加価値製品全般への応用などが想定されます。
		衣服圧測定のための 歩行型腰部柔らかかダミー (20分)	内部に骨格を有する、歩行動作再現可能な衣服圧測定用ダミー。これまで被験 者実験のみでしか測定できなかった動作による評価が可能で、インナーウェア、 スポーツウェア開発等への活用が期待されます。
16:40 ～17:00	神奈川県 産業技術 センター	屋根用遮熱塗料顔料 (10分)	相反する特性(暗色かつ高赤外線反射率)を持つ塗料顔料の開発。屋根用遮熱 塗料、道路用遮熱塗料など、暗色でありながら赤外線吸収率が少ないことを要 求される物の表面に色づけする製品への展開などが想定されます。
		新形態の酸化チタン光触媒の紹介 (10分)	チタン粒子の大きな凝集体を作成する技術を開発。その凝集径は市販品の凝集 径の15倍以上で取り扱い易いサイズに、また、光触媒活性も大きく向上。従来品 より性能や使い勝手に優れた酸化チタン製の脱臭剤、水処理剤、抗菌剤、防汚 剤等の開発が想定されます。
17:00	閉会		

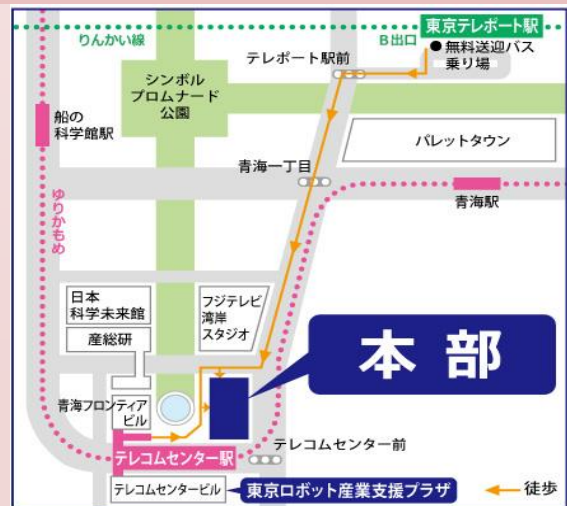
会場（東京都立産業技術研究センター）へのアクセス

★新交通ゆりかもめ「テレコムセンター」駅前

「テレコムセンター」まで 新橋駅から18分
豊洲駅から12分

★りんかい線「東京テレポート」駅下車 徒歩15分(駅から無料送迎バスあり)

「東京テレポート」駅まで 新宿駅から23分
池袋駅から28分



地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター本部 中2階
東京イノベーションハブ (江東区青海2-4-10)

■申込者情報のお取り扱いについて■

利用者 (公財)東京都中小企業振興公社(東京都知的財産総合センター)

利用目的 1 当該事業の事務連絡や運営管理・統計分析のために使用します。

2 各種事業案内やアンケート調査依頼等を行う場合があります。

※上記2を希望されない方は当該事業担当者までご連絡ください。

※個人情報「個人情報の保護に関する要綱」に基づき管理しております。当要綱は、公社ホームページ
(<http://www.tokyo-kosha.or.jp>)より閲覧及びダウンロードすることができますので併せてご参照ください。